

«Микрон» начал тестирование первого российского фоторезиста для микросхем 90 нм

Компания «Микрон», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», тестирует первый отечественный фоторезист для производства микросхем по 90-нанометровому процессу. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Разработка позволит снизить зависимость от зарубежных материалов в микроэлектронике.

Фоторезист — светочувствительный материал, используемый при создании микросхем методом фотолитографии. Его производство в России ранее не было налажено из-за отсутствия собственного оборудования. Новый материал создан НИИ молекулярной электроники при поддержке Минпромторга. По словам гендиректора НИИ Александра Кравцова, он обладает свойствами, сопоставимыми с иностранными аналогами.

«Микрон» — единственный в стране производитель микросхем с топологией 180–90 нм. Его продукция применяется в картах «Мир», загранпаспортах, транспортных картах «Тройка». Предприятие имеет около 80 патентов и уже внедрило 16 отечественных химических материалов, а также 25 специальных газов для производства.

Гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова подчеркнула, что импортозамещение требует кооперации с научными центрами. Это ускоряет переход от исследований к серийному выпуску. Разработка фоторезиста для 90 нм — важный шаг для отрасли, так как позволяет сохранить действующие производства без остановки.

В «Технополисе Москва» также создан первый российский фотолитограф для техпроцесса 350 нм.